

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年11月9日(2006.11.9)

【公表番号】特表2003-503581(P2003-503581A)

【公表日】平成15年1月28日(2003.1.28)

【出願番号】特願2001-506758(P2001-506758)

【国際特許分類】

C 1 1 D 1/825 (2006.01)

C 1 1 D 1/72 (2006.01)

C 1 1 D 1/722 (2006.01)

C 1 1 D 1/75 (2006.01)

C 1 1 D 1/82 (2006.01)

C 1 1 D 3/34 (2006.01)

C 1 1 D 3/37 (2006.01)

C 1 1 D 17/08 (2006.01)

【F I】

C 1 1 D 1/825

C 1 1 D 1/72

C 1 1 D 1/722

C 1 1 D 1/75

C 1 1 D 1/82

C 1 1 D 3/34

C 1 1 D 3/37

C 1 1 D 17/08

【手続補正書】

【提出日】平成18年9月12日(2006.9.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複合汚れを基体から除去する方法であって、

(a) (i) 約0.003～約35wt%の1種以上の非イオン界面活性剤、

(ii) 約0.0005～約35wt%の1種以上のシリコーン界面活性剤、ここで非イオン界面活性剤対シリコーン界面活性剤の質量比は、シリコーン界面活性剤の各部当り非イオン界面活性剤が約0.1～約10質量部であるような比である、および

(iii) 組成物を均一な溶液として維持するに十分な、約0.001～約20wt%の1種以上のヒドロトロップ、

を含み、ここで非イオン界面活性剤、シリコーン界面活性剤、およびヒドロトロップは、水性媒体と接触させて洗浄剤組成物の水性溶液を生成する場合に、この水性溶液が曇り、安定となるような割合に選択される洗浄剤組成物と、基体および複合汚れとを接触させること、および

(b) 除去された複合汚れを形成すること、ここでこの複合汚れは有機相に分散した無機汚れ相を含む、

(c) 組成物および除去された汚れを除去すること、を含む方法。

【請求項2】 前記組成物が約0.001～約30wt%のキレート剤をさらに含み、

非イオン系として x が 2 より大きい $(EO)_x$ 基を持つ界面活性剤を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記ヒドロトロープが C_{6-24} アルキルジメチルアミンオキシドを含み、キレート剤がカルボキシ置換ポリマー組成物を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記非イオン界面活性剤が、 y および z が独立に 2 ~ 100 の間にあ
る 2 ~ 15 モルの EO を有する、少なくとも一つの $(EO)_y(PO)_z$ および C_{6-18} アル
キルフェニルアルコキシレートを含むブロックコポリマーを含む、請求項 1 に記載の方法
。